

東京応化工業株式会社

「今後の方針」

～ 「tokチャレンジ21」を踏まえて～

2002年5月22日

目次

1. 「tokチャレンジ21」ポイント・レビュー
2. 活動計画の進捗状況
3. 今後の方針

「tokチャレンジ21」

主要活動計画

全社的戦術

グローバル化推進戦術

ランクアップ戦術

SE戦術

新規戦術

事業別活動計画

電子材料

ディスプレイ材料

画像材料

装置

これまでの実績と着地見通し

(百万円)

	2001/3	2002/3	2003/3 (予想)
売上高	83,456	73,297	69,700
電子材料	46,823	35,288	38,000
ディスプレイ材料	10,059	9,649	11,400
画像材料	12,132	10,119	10,500
装置	14,440	18,240	9,700
営業利益	9,298	2,618	3,700
経常利益	10,673	3,019	3,800
当期純利益	3,250	1,314	2,100

活動計画の進捗状況

進捗状況

■グローバル化推進戦術

- ◇ 露光機メーカーとArFリソグラフィ技術の協力体制確立
- ◇ ArF量産技術に係る共同開発プロジェクトを相次ぎ発足
- ◇ 台湾拠点での付属薬品類生産拡大

■ランクアップ戦術

- ◇ 最先端ラインでのKrF採用獲得（韓国）
- ◇ シュリンク技術の共同開発（欧州）
- ◇ パッケージ材料（ノンシアン）の拡販（台湾）

■S E 戦術

- ◇ 「グローバル化推進戦術」・「ランクアップ戦術」推進の原動力
- ◇ 体制構築・活動を積極化

進捗状況

■ 主な新規戦術の成果

■ 半導体関連

- ◇ ArF商業化
- ◇ Cuダマシン用剥離液

■ FPD関連

- ◇ PDP材料
(リブ加工用DFR、フォト蛍光体ペースト、電極形成用フォトレジストなど)
- ◇ 液晶カラーフィルターBM形成用レジスト
- ◇ 液晶パネル用平坦化膜

■ 上記以外

- ◇ 大型カラーフィルター用塗布装置

今後の方針

グローバル化推進戦術：成果を出す

グローバルな視点

Face to Face

マーケティング
SE

情報

R&D

生産
品質管理

全社売上の増加

技術力・サポート力の向上

- 情報 = ユーザーニーズ
 - R&D能力を引き出す
 - 的確なサポートを実現する

R&D:スピードと効率性を更に重視

■ コラボレーションの積極推進

- ◇ スピードと効率性を重視

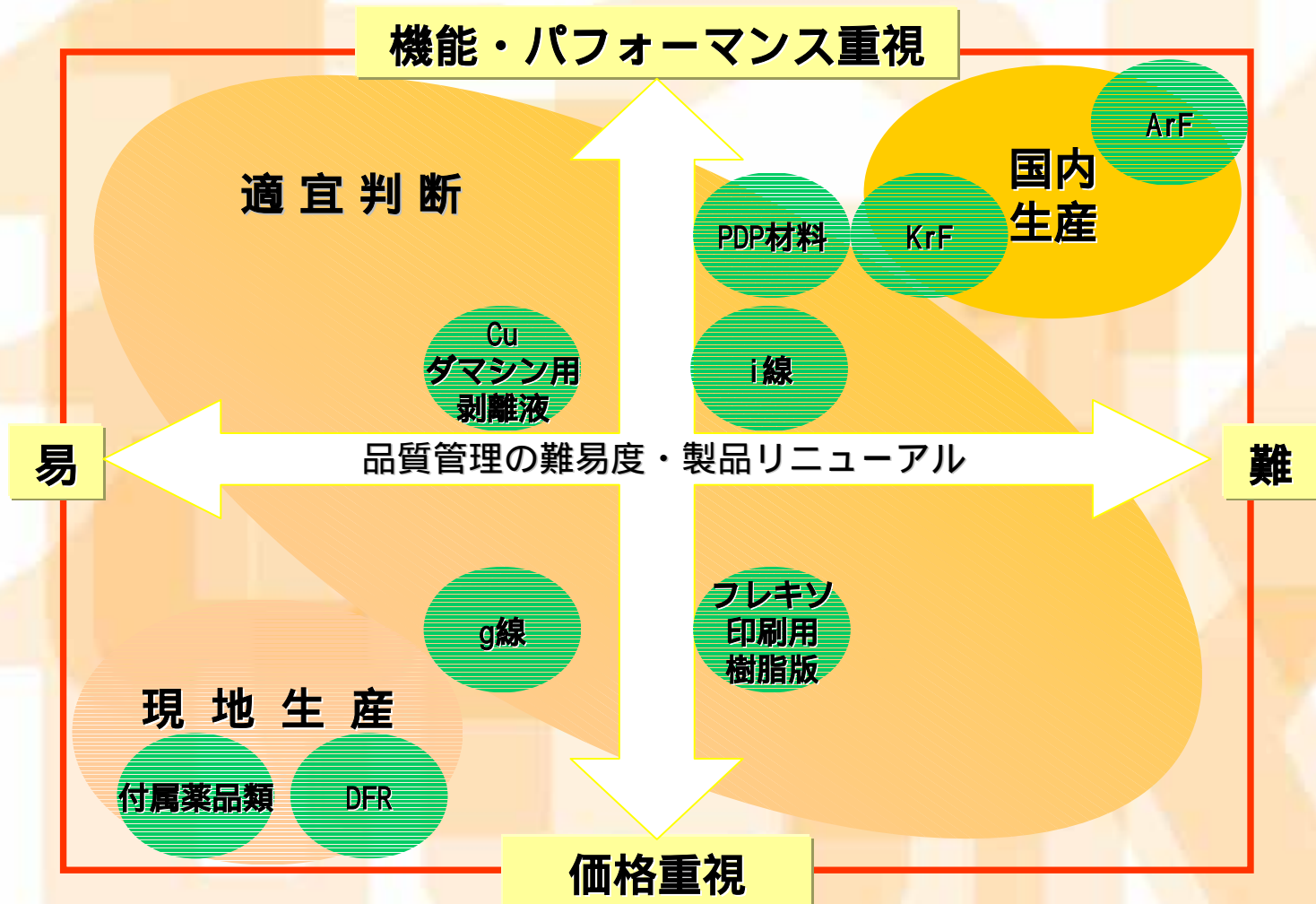
■ R & D活動の中心、主体は日本

- ◇ 研究員、情報、研究機器投資の集中メリットを追求

■ フォトポリマー技術の更なる研鑽

- ◇ ニューレジン試作を視野に（研究開発棟建設着手）

海外（現地）生産：推進方向



ランクアップ戦術：対象拡大・加速

グローバル化推進戦術

「ランクアップ戦術」の徹底
= ユーザー1社当たりの売上高増大

取引高の増大（製品別）

製品ラインナップ拡充

例えば、半導体フォトレジストでは...

- 既設ラインでの取引シェアアップ
 - 同一グレード・同一用途
 - 同一グレードの用途拡大
 - 微細化進行による新規グレード採用
- ライン新設に伴う製品採用

S E 戦術：強化、更に強化

■ Human Resource の充実

- ◇ 充実した研究開発機器の活用 レベルアップ
- ◇ 供給ソース 日本

■ OAI 強化

- ◇ 米国におけるランクアップ戦術を強力支援
- ◇ 人員増強

■ 拠点拡充

- ◇ 中国・東南アジア市場も視野に（上海・シンガポール事務所）
- ◇ 欧州大陸拠点としてOEL（オランダ）を強化

新規戦術：本格展開開始

新規戦術

【Needsの充足】
新たなニーズへの対応
ユーザー関係の強化

【Seedsの拡充】

収益源の多様化
事業基盤の強化

研究・開発

上市・改良上市

Low-k材
($k=2.5\sim 2.6$)

NGL
(F_2 、EUV)

マイクロマシン
材料

ArF

CSP等
パッケージ材料

液晶パネル用
平坦化膜

磁気ヘッド
製造プロセス
材料

拡販・改良拡販

BM形成用
レジスト

PDP材料

今後の課題

■ 検討もしくはブラッシュアップする課題

- ◇ M&E展開
- ◇ マーケティング機能の更なる強化
- ◇ 新製品開発・上市の加速

■ 次期「中期経営計画」策定